29aB04

LHD に於ける NBI 単独プラズマ立上げのモデリング

Modeling of Plasma Startup by NBI in LHD

金子修、竹入康彦、岡良秀、津守克嘉、長壁正樹、池田勝則、LHD実験グループ

核融合科学研究所

ヘリカル装置では従来初期プラズマ生成法としてECHを用いてきたが、この方法では共鳴磁場条件が制約 となり高ベータ実験等、任意の磁場強度での実験を行うことが難しい。そこで磁場依存性の少ないプラズマ生 成法が望まれていた。LHDでは一昨年の実験に於いてNBIを真空磁場の存在下で薄い水素ガス中に入射し 続けることによりプラズマが生成されることを見いだし、昨年はこれを低磁場での標準プラズマ生成法として 確立させた。プラズマが生成される原理は、NBIが自身で持ち込む水素ガスとの衝突によりわずかではある が電離して出来た高速イオンが真空磁場内に閉じ込められ、水素ガスの電離・加熱のエネルギー源となってい る為と考えられる。実験的にはNBIの入射のみで薄いプラズマが観測され始めた後ある程度時間が経ってか ら(入射開始後0.3秒程度)ガスパフを行うと高密度プラズマが立ち上がり、これより早いタイミングにガ スパフを行ってもプラズマは立ち上がらない。これはガスパフされた大量のガス粒子を電離させるためには、 NBIのみで作られるプラズマの温度がある程度高くなっている必要がある為と思われる。

NBIのみで作られるプラズマの温度がある程度高くなっている必要がある為と思われる。 これらのことを確認するために、ガスターゲットでのNBIによるプラズマ生成過程をワンポイントモデル で解析した。考慮した過程としては、(1)高速イオンの生成と荷電交換による損失、(2)高速イオンによる 電離及び出来たプラズマの加熱、(3)中性ガスの電離による電子密度の時間発展、(4)電子温度及びイオン 温度の時間発展、である。電子密度に関しては関心のある時間帯で密度は低く大きな損失は無いとしている。 電子温度に関しては、加熱源は高速イオン、エネルギー損失過程としては放射とイオンとの衝突のみを考え拡 散等は考慮していない。イオン温度に関しては、加熱源は高速イオンと電子、損失は中性ガスとの荷電交換の みを考えている。その結果、電離が進み中性粒子密度が小さくなると電子・イオン温度が上昇を始め最終的に は完全電離した高温プラズマが出来る。この段階でガスパフをすると高温プラズマ自身が電離を促進し冷却に 耐えてプラズマ密度が上昇しNBIのターゲットプラズマに成長する。この間に要する時間は実験条件の値の 下で約0.3秒となり実験結果をよく説明する。又、電子温度変化を反映していると思われる実験的に観測さ れる炭素や酸素の放射レベルの時間変化も良く説明され、上記モデルの妥当性が示された。

29aB05

LHDにおける ICRF の波動伝搬と輸送解析

Theoretical Studies of ICRF Heating Process of LHD

渡辺二太,^A永浦辰彦,^A松本裕,^A及川俊一 核融合科研,^A北大院工

トロイダル磁場コイルの存在しない LHD ではピッチ角の立っている 粒子(磁力線に垂直方向速度の大きい粒子)の方が閉じこめやすい(無衝 突軌道).ひとたび加熱された高エネルギーイオンは有限ラーモア半径効 果で右回り円偏波であった磁気音波からも有効に高周波エネルギーを吸 収できるので加熱が一層加速される.少数高エネルギーイオンの役割を波 動伝搬と輸送解析の観点から解析した.解析には次の理論モデルを用い た.① LHDの真空容器を巨大な空洞共振器(Cavity Resonator)と見 なす.高周波電磁場は真空容器内での多重反射を繰り返しながら高エネ ルギーイオンに吸収される(サイクロトロン共鳴加熱).② ICRF 電力 の、真空容器に取り付けられた多数の観測孔からの漏洩.および真空容 器壁での抵抗損失等は、プラズマの外周と真空容器壁間の領域の平均的 電磁場強度で決定されていると仮定する.この両者を結びつける係数はプ ラズマが存在しないときの真空容器のQ値(=Q₀)で与える.③高エネ ルギーイオンは炉心プラズマの電子、イオンとクーロン衝突することで減 速する.その結果次のような結果を得た.

- LHDのICRF加熱に少数イオンの添加は不要である.少量の高エネ ルギーイオン (遁走イオン)が自動的に生成されICRF電力を効率的 に吸収する.加熱効率はほぼ1に近い.
- LHD プラズマを維持する ICRF 加熱電力には閾値 (下限) が存在す る.この閾値はプラズマ密度で定まる (図参照).
- o ICRFで生成される高エネルギーイオン (遁走イオン)の温度は ICRF

のスペクトルと電子温度で決定され、プラズマ密度,ICRF 電力には ほとんど依存しない.

図の説明: プラズマ密度を $10^{19}m^{-3}$ に維持したときの アンテナから投入 された電力とプラズマパラメータの関係. η_H は加熱効率を示す.

